

(11)特許出願公開番号

特開平8-166475

(43)公開日 平成8年(1996)6月25日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G 1 2 B 5/00

T 6947-2F

H O 1 L 21/68

G

審査請求 未請求 請求項の数33 O L (全 13 頁)

(21)出願番号 特願平7-75223

(22)出願日 平成7年(1995)3月31日

(31)優先権主張番号 221375

(32)優先日 1994年4月1日

(33)優先權主張国 米国 (US)

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 マーティン イー. リー

アメリカ合衆国、95070 カリフォルニア、

サラトガ、ピック　ベイシン　ウェイ

24100

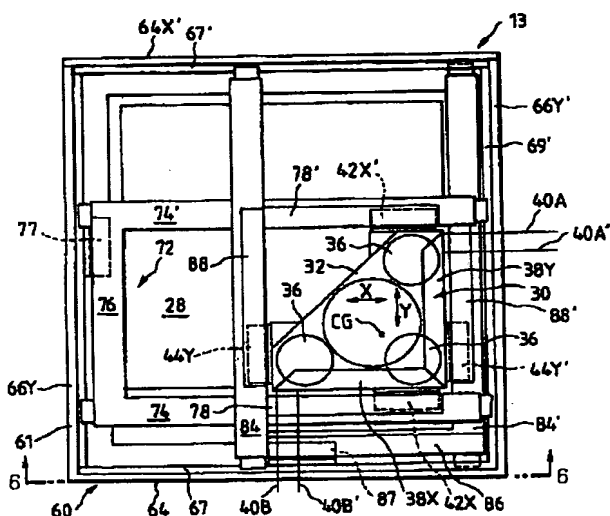
(74)代理人 弁理士 岡部 正夫 (外5名)

(54) 【発明の名称】 位置決め装置、アライメント装置、及び、位置決め方法

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】対象物の運動により生ずる反力及び振動が、レンズ系の如き他の要素に伝達しないように、対象物を支持、位置決め、及び、制御する。

【構成】外部振動、及び、対象物ステージ30からの反力によって生ずる振動を絶縁する反作用フレーム61を備える。対象物ステージは2つの方向に運動する。反作用フレームは、2つの従動子を備える。協働する直動型の力アクチュエータが、対象物ステージ及び従動子にに設けられ、対象物ステージを第1及び第2の方向において位置決めする。反作用フレームは、ベース構造に取り付けられ、対象物ステージは、反作用フレームと独立して空間に支持される。従動子72は、一対のアーム74、74'を有し、対象物ステージの重心がある一対の平行な平面の中で運動する。アクチュエータ駆動手段の位置決め力は、対象物ステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロになるように制御される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベース構造上で作動する位置決め装置において、

(a) 前記ベース構造に取り付けられた反作用フレームを含む反作用フレームアセンブリと、

(b) 対象物ステージのベースに対して相対的に運動する対象物ステージと、

(c) 前記反作用フレームとは独立して前記対象物ステージを前記対象物ステージのベースから間隔をおいて支持するための手段と、

(d) 前記対象物ステージ及び前記反作用フレームアセンブリに取り付けられ、前記対象物ステージを位置決めするための一対になって協働し、力を発生する直動型のアクチュエータ手段とを備え、
前記対象物ステージのベース及び前記対象物ステージが、前記アクチュエータ手段からの反力から絶縁され、これにより、前記対象物ステージのベース及び前記対象物ステージへの振動の伝達が最小となることを特徴とする位置決め装置。

【請求項2】 請求項1の位置決め装置において、前記反作用フレームアセンブリが、前記対象物ステージに独立して運動して追従することのできる従動子を備えることを特徴とする位置決め装置。

【請求項3】 請求項1の位置決め装置において、前記アクチュエータ手段が、前記対象物ステージと前記反作用フレームアセンブリとの間で作動する、少なくとも1つのリニアモータを備えることを特徴とする位置決め装置。

【請求項4】 請求項1の位置決め装置において、前記対象物ステージを位置決めするための少なくとも一組のアクチュエータ手段を備え、これら各々のアクチュエータ手段が、前記対象物ステージに取り付けられた駆動部材を有することを特徴とする位置決め装置。

【請求項5】 請求項4の位置決め装置において、前記駆動部材の位置決め力に起因する、前記対象物ステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とする位置決め装置。

【請求項6】 請求項2の位置決め装置において、前記対象物ステージに取り付けられた少なくとも1つの駆動部材を備えることを特徴とする位置決め装置。

【請求項7】 請求項2の位置決め装置において、前記従動子が、2つの平行な平面の中でそれぞれ運動可能な2つのアームを備えており、前記2つの平面の間に、前記対象物ステージの重心があることを特徴とする位置決め装置。

【請求項8】 請求項1の位置決め装置において、前記対象物ステージは、第1の方向、及び、該第1の方向と角度をなす第2の方向において少なくとも運動可能であり、第1の従動子が、前記第1の方向においてのみ可動であり、前記対象物ステージに追従し、また、第2の従

10

20

30

40

50

動子が、前記第2の方向においてのみ可動であり、前記対象物ステージに追従し、前記協働するアクチュエータ手段は、前記対象物ステージ及び前記第1及び第2の従動子に設けられ、前記対象物ステージを前記第1及び第2の方向において位置決めすることの特徴とする位置決め装置。

【請求項9】 請求項8の位置決め装置において、前記アクチュエータ手段は、前記対象物ステージと前記反作用フレームアセンブリとの間で作動する、少なくとも3つの力を発生する直動型アクチュエータを備えることを特徴とする位置決め装置。

【請求項10】 請求項9の位置決め装置において、前記少なくとも3つの直動型アクチュエータのうちの2つが、前記第1の方向に前記対象物ステージを駆動するように設けられ、協働するアクチュエータ手段の位置決め力に起因する、前記対象物ステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とする位置決め装置。

【請求項11】 請求項10の位置決め装置において、前記2つの直動型アクチュエータ以外の前記直動型アクチュエータの1つが、前記対象物ステージを前記第2の方向に駆動するように、前記対象物ステージに取り付けられ、前記協働するアクチュエータ手段の位置決め力に起因する、前記対象物ステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とする位置決め装置。

【請求項12】 請求項8の位置決め装置において、前記対象物ステージを位置決めするための少なくとも2組の直動型アクチュエータを備え、これら直動型アクチュエータのうちの1組は、前記対象物ステージを前記第1の方向において位置決めし、前記直動型アクチュエータのうちのもう1組は、前記対象物ステージを前記第2の方向において位置決めし、これら協働するアクチュエータ手段の位置決め力に起因する、XYステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とする位置決め装置。

【請求項13】 請求項8の位置決め装置において、前記第1及び第2の従動子は各々、隔置された2つのアームを有しており、一方の従動子のアームは、単一の平面の中に位置して運動可能であり、また、他方の従動子のアームは、前記単一の平面がその間に位置する2つの平行な平面の中に位置して運動可能であることを特徴とする位置決め装置。

【請求項14】 請求項13の位置決め装置において、前記対象物ステージの重心が、前記単一の平面の中に、あるいは、該単一の平面に隣接して位置することを特徴とする位置決め装置。

【請求項15】 位置決め装置において、

(a) 第1の方向、及び、該第1の方向に角度をなす第2の方向において、少なくとも運動する対象物ステー

ジと、

(b) 前記第1の方向においてのみ可動であり、前記対象物ステージに追従する第1の従動子と、

(c) 前記第2の方向においてのみ可動であり、前記対象物ステージに追従する第2の従動子と、

(d) 前記対象物ステージ、並びに、前記第1及び第2の従動子に取り付けられ、前記対象物ステージを前記第1及び第2の方向において位置決めするための、協働する直動型の力アクチュエータ手段とを備えることを特徴とする位置決め装置。

【請求項16】 請求項15の位置決め装置において、前記アクチュエータ手段は前記対象物ステージと前記各従動子との間で作動する、少なくとも3つの直動型力アクチュエータを備えることを特徴とする位置決め装置。

【請求項17】 請求項16の位置決め装置において、前記少なくとも3つの直動型アクチュエータのうちの2つが、前記第1の方向に前記対象物ステージを駆動するように設けられ、協働するアクチュエータ手段の位置決め力に起因する、前記対象物ステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とする位置決め装置。

【請求項18】 請求項17の位置決め装置において、前記2つの直動型アクチュエータ以外の前記直動型アクチュエータの1つが、前記対象物ステージを前記第2の方向に駆動するように、前記対象物ステージに取り付けられ、前記協働するアクチュエータ手段の位置決め力に起因する、前記対象物ステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とする位置決め装置。

【請求項19】 請求項15の位置決め装置において、前記対象物ステージを位置決めするための少なくとも2組の直動型アクチュエータを備え、これら直動型アクチュエータのうちの1組は、前記対象物ステージを前記第1の方向において位置決めし、前記直動型アクチュエータのうちのもう一方は、前記対象物ステージを前記第2の方向において位置決めし、これら協働するアクチュエータ手段の位置決め力に起因する、対象物ステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とする位置決め装置。

【請求項20】 請求項15の位置決め装置において、前記第1及び第2の従動子は各々、隔置された2つのアームを有しており、一方の従動子のアームは、単一の平面の中に位置して運動可能であり、また、他方の従動子のアームは、前記単一の平面がその間に位置する2つの平行な平面の中に位置して運動可能であることを特徴とする位置決め装置。

【請求項21】 請求項20の位置決め装置において、前記各々の従動子は、少なくとも1つの駆動部材を有しており、協働する駆動部材の位置決め力に起因する、前記対象物ステージの重心における力のモーメントのベク

トル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とする位置決め装置。

【請求項22】 請求項20の位置決め装置において、前記対象物ステージの重心が、前記単一の平面の中に、あるいは、該単一の平面に隣接して位置することを特徴とする位置決め装置。

【請求項23】 請求項15の位置決め装置において、対象物ステージのベースと、ベース構造に設けられた反作用フレームを有する反作用フレームアセンブリと、前記各従動子を前記反作用フレームアセンブリから支持するための手段と、前記反作用フレームとは独立して前記対象物ステージを、前記対象物ステージのベースから間隔において、支持するための手段とを備え、これにより、前記対象物ステージのベース及び前記対象物ステージが、それぞれの反力により生ずる振動から絶縁され、従って、前記対象物ステージのベース及び前記対象物ステージの振動が、最小になるように構成されたことを特徴とする位置決め装置。

【請求項24】 アライメント装置において、

(a) 重心を有するXYステージと、

(b) 前記XYステージをXYステージのベースから間隔において支持するための手段と、

(c) 前記XYステージのベースとは独立した、反作用フレームのベース上に支持された反作用フレームを有する反作用フレームアセンブリとを備え、

(d) 前記反作用フレームアセンブリは、独立して運動可能なX従動子及び独立して運動可能なY従動子を有しており、前記反作用フレームに運動可能に取り付けられた前記X従動子は、X方向に運動可能であり、また、前記反作用フレームに運動可能に取り付けられた前記Y従動子は、Y方向に運動可能であり、

(e) 前記X従動子及びY従動子の一方は、少なくとも2つの隔置されたアームを有し、前記X従動子及びY従動子の他方は、少なくとも1つのアームを有しており、

当該アライメント装置は更に、

(f) 前記XYステージと前記各従動子の間に隔置された関係で設けられ、前記XYステージを水平方向に位置決めするための一対の協働し力を発生する直動型アクチュエータ手段を備え、

(g) 前記アクチュエータ手段は、前記各々の従動子のアームに設けられた駆動部分要素手段と、それに対して前記XYステージに設けられ、前記駆動部分要素手段と協働して前記XYステージを位置決めする、駆動主要部材手段とを備えており、

前記XYステージのベース、及び、前記XYステージは、反力によって生ずる振動から絶縁され、これにより、前記XYステージのベース及び前記XYステージの振動が、最小になるように構成されたことを特徴とするアライメント装置。

5

【請求項25】 請求項24のアライメント装置において、前記X従動子及びY従動子のうちのどちらか一方に設けられた前記1つのアームは、単一の平面において運動可能であり、前記X従動子及びY従動子のもう一方に設けられた前記1つのアームである2つのアームは、その間に前記単一の平面が位置する2つの独立した平面にそれぞれ位置し、該平面の中で運動可能であることを特徴とするアライメント装置。

【請求項26】 請求項25のアライメント装置において、前記1つの従動子の前記1つのアームに設けられる前記駆動部分要素手段を有し、それを制御するための手段を備え、協働する駆動主要部材手段の位置決め力に起因する、前記XYステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しいことを特徴とするアライメント装置。

【請求項27】 対象物を位置決めするための方法において、

- (a) 反作用フレームをベース上で位置決めする工程と、
- (b) 対象物を対象物ステージ上で支持する工程と、
- (c) 前記対象物を、前記反作用フレームとは独立して、対象物ステージのベースからある位置に前記対象物ステージを空間上で支持する工程と、
- (d) 前記対象物ステージと前記反作用フレームとの間に力を加え、前記対象物ステージを空間上の少なくとも1つの方向の新しい位置に駆動して、同時に、前記力を加えることにより生ずる反力から前記対象物ステージのベースを絶縁する工程とを備えることを特徴とする位置決め方法。

【請求項28】 少なくとも第1の従動子及び第2の従動子によって、第1の方向及び第2の方向に動かすことにより、対象物ステージを空間に位置決めする方法において、

- (a) 前記対象物ステージを空間に支持する工程と、
- (b) 前記対象物ステージと前記第1の従動子との間に力を加えて、前記対象物ステージを前記第1の方向においてのみ駆動する工程と、
- (c) 前記対象物ステージと前記第2の従動子との間に力を加えて、前記対象物ステージを前記第2の方向においてのみ駆動する工程と、
- (d) 前記第2の方向においてのみ、且つ、前記第2の従動子とは独立して、前記第1の従動子を駆動して、前記対象物ステージに追従させる工程と、
- (e) 前記第1の方向においてのみ、且つ、前記第1の従動子とは独立して、前記第2の従動子を駆動して、前記対象物ステージに追従させる工程とを備えることを特徴とする対象物の位置決め方法。

【請求項29】 請求項1の位置決め装置において、前記対象物ステージと前記反作用フレームとの間で前記アクチュエータ手段を取り付けする手段を備え、該取り付

6

けが、少なくとも駆動力方向において堅固であることを特徴とする位置決め装置。

【請求項30】 請求項15の位置決め装置において、前記対象物ステージと前記各従動子との間で前記アクチュエータ手段を取り付けする手段を備え、該取り付けが、少なくとも前記駆動力方向において堅固であることを特徴とする位置決め装置。

【請求項31】 請求項24の位置決め装置において、前記XYステージと前記各従動子との間で前記アクチュエータ手段を取り付けする手段と備え、該取り付けが、少なくとも前記駆動力方向において堅固であることを特徴とする位置決め装置。

【請求項32】 平面を有するベースプレートと、該平面な上で所定の方向に沿って運動可能なステージを有するが協働するようになされた精密位置決め装置において、

(a) 前記ベースプレートを基礎上に支持するための第1の支持アセンブリと、

(b) 前記所定の方向に沿って前記運動可能なステージに、電磁力を与えるためのアクチュエータアセンブリとを備え、該アクチュエータアセンブリが、(i) 前記運動可能なステージに取り付けられて前記所定の方向に運動することのできる運動可能な被動部、及び、(ii) 前記運動可能なステージの周囲に位置する駆動部を具備し、(iii) 前記被動部及び前記駆動部の一方が、コイルユニットを有し、また、前記被動部及び前記駆動部の他方が、磁気ユニットを有しており、更に、

(c) 前記駆動部を前記第1の支持アセンブリとは独立して前記基礎の上に支持し、これにより、前記コイルユニットと前記磁気ユニットとの間に所定のギャップを形成する、第2の支持アセンブリを備えることを特徴とする精密位置決め装置。

【請求項33】 請求項32の精密位置決め装置において、前記アクチュエータアセンブリの前記駆動部が、前記所定の方向に対して、静止した位置に保持されることを特徴とする精密位置決め装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、一般に、電気機械的な照準整合すなわちアラインメント及び振動絶縁に関し、特に、マイクロリソグラフ装置においてウェーハを支持及びアライメントし、その装置を、それ自身の反力及び外部振動から絶縁するための方法及び装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 マイクロリソグラフ機器に使用される種々の支持機構、及び、位置決め機構が知られている。従来技術においては一般に、別個のXガイドアセンブリ、及び、Yガイドアセンブリを備えるXYガイドが用いられており、一方のガイドアセンブリが、他方のガイドアセンブリの上に運動可能に取り付けられている。上記ガ

イドアセンブリの頂部には、別個のウエーハステージが設けられることが多い。そのような構造は、高い精度及び多くの部品を必要とする。一般に、位置決めアセンブリの部品に加わる外力、及び、上記位置決めアセンブリのその他の部品の運動に起因する反力は、像形成光学系及びレティクル（焦点板）を処理する機器に直接伝達され、その結果望ましくない振動を生ずる。

【0003】米国特許第5,120,03号（Van Engelen et al.）は、光学式リソグラフ装置用の二段階式の位置決め装置を開示しており、この位置決め装置は、ローレンツ力及び静圧ガス軸受を用いている。

【0004】米国特許第4,952,858号は、電磁アライメント装置を用いたマイクロリソグラフ装置に関するものであり、上記電磁アライメント装置は、モノリシックステージと、サブステージと、振動絶縁された基準構造とを備えており、上記モノリシックステージとサブステージとの間に設けられる力アクチュエータを用いて、上記モノリシックステージを空間上に支持し位置決めしている。この装置においては、YフレームすなわちYステージが、Xフレームに取り付けられ、また、上記モノリシックステージが、上記Yフレームから空間を置いて支持されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明の全体的な目的は、対象物が運動する際に生ずる外力並びに反力の両方を、ウエーハの対象表面上のホトレジストに露光される像を生成するレンズ系の如き他の要素から絶縁する反作用フレームを備えると共に、上記対象物を支持するためのガイドレスステージを利用する方法及び装置を提供することである。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明の装置は、対象物ステージと、ベースに取り付けられると共に、それ自身と対象物ステージとの間に振動が実質的に伝達されない反作用フレームと、上記対象物を、上記反作用フレームとは独立して空間に支持するための手段と、対象物ステージ及び反作用フレームに設けられ、対象物ステージを位置決めするための一対になって協働し、力を発生する直動型アクチュエータ手段とを備える。対象物ステージは、Z方向においては空間に支持された状態で、所定の方向に運動するように設けることができ、あるいはX方向及びY方向に運動するXYステージを構成することができる。

【0007】本発明の効果的な特徴は、支持、位置決め及び振動絶縁するアセンブリを提供することであり、このアセンブリは、対象物又はウエーハのステージの実行すべき位置決め機能を可能とし、その際に、反作用を受けたステージから上記ステージ及びレンズ系に伝達される振動を、少ない部品で迅速に、極めて少なくし、同時

に、上記ステージに伝達される振動を最小化すると共に、上記ステージを望ましくない反力から絶縁する。

【0008】本発明の別の特徴によれば、XYステージ用の位置決め方法及び位置決め装置が提供され、上記XYステージは、独立して運動可能なX従動子及び独立して運動可能なY従動子、並びに、上記XYステージと各従動子との間に設けられて協働する、直動型の力アクチュエータを備えており、これにより、いずれの従動子の運動も、他方の従動子の運動を干渉しないようになされている。

【0009】本発明の別の特徴によれば、少なくとも1つの従動子に一对のアームが設けられ、各々のアームは、駆動部材を有しており、上記アームは、対象物ステージの重心の上方及び下方に隔置された平面に位置して、該平面の中で運動可能である。

【0010】本発明の別の特徴によれば、上記ガイドレスステージは、少なくとも3つの直動型の力アクチュエータを備えており、これらアクチュエータの2つは、X方向及びY方向の一方に駆動し、第3のアクチュエータは、X方向及びY方向の他方に駆動する。本発明の好ましい実施例によれば、ガイドレスステージは、XYステージと反作用フレームアセンブリとの間に、少なくとも4つの直動型アクチュエータを備え、各々のアクチュエータは、XYステージに設けられる駆動部材を有しており、これにより、一对のX駆動部材が、XYステージをX方向に駆動し自動制御する役割を果たし、また、一对のY駆動部材が、XYステージをY方向に駆動し自動制御する役割を果たす。直動型アクチュエータ、及び、これらの駆動部材は、協働する駆動部材の位置め力に起因する、XYステージの重心における力のモーメントのベクトル和が、実質的にゼロに等しくなるように、構成され、位置決めされ、制御される。

【0011】本発明の特徴及び効果は、全体を通じて同様の参照符号が同様の部分を示している図面を参照して、以下の説明を読むことにより、より明らかとなる。

【0012】

【実施例】振動絶縁反作用フレームを有するあるいは有しない、ガイドレスステージは、対象物を正確に位置決めするための多くの異なるタイプの機器に対する多くの用途を有していることは、当業者には理解されようが、本発明は、ウエーハ表面のホトレジストに露光される像をレンズが形成する装置において、ウエーハをアライメントするためのマイクロリソグラフ装置の形態の好ましい実施例に関して説明する。また、振動絶縁ステージを有するあるいは有しないガイドレスステージは、例えば、X方向又はY方向の一方向にだけ運動可能な、ガイドレス対象物ステージとして利用することができるが、本発明の好ましい実施例は、以下に説明するガイドレスのXYウエーハステージに関して説明される。

【0013】図面、特に図1乃至図5を参照すると、上方の光学装置12と、下方のウエーハ支持位置決め装置13とを備えるホトリソグラフ装置10が示されている。光学装置12は、水銀ランプの如きランプLMPと、該ランプLMPを包囲する楕円面鏡EMとを備える照明器14を備えている。照明器14は、ハエの目型のレンズFELの如き、二次光源像を生成するための光学積分器と、均一化された光束でレティクル（マスク）Rを照射するための集光レンズCLとを備えている。マスクRを保持するマスクホルダRSTが、投影光学装置16の鏡筒PLの上方に取り付けられている。鏡筒PLは、絶縁パッドすなわちブロック装置20の頂部に各々取り付けられた複数の剛性の高いアーム18上に支持されている、柱アセンブリの一部に固定されている。

【0014】慣性ブロックすなわち振動吸収ブロック22が、アーム18に取り付くように装置に設けられている。上記ブロック22は、重量のある構造物を輸送するのを避けるために空の状態で輸送した後、操作現場で砂を充填することのできる、鋳造された箱の形態を取ることができる。対象物ステージすなわちウエーハステージのベース28が、垂下するブロック22、垂下するパー26、及び、水平パー27によって、アーム18から支持されている（図2参照）。

【0015】図5乃至図7を参照すると、対象物ステージすなわちウエーハステージのベース28の上のウエーハ支持位置決め装置の平面図及び立面図がそれぞれ示されており、上記ウエーハ支持位置決め装置は、対象物（ウエーハ）XYステージ30と、反作用フレームアセンブリ60とを備えている。XYステージ30は、サポートプレート32を備えており、このサポートプレートの上には、12インチ（304.8mm）ウエーハの如きウエーハ34が支持されている。プレート32は、Zを調節するように、すなわち、傾斜、横転及び焦点を調節するように制御することのできる、真空予圧型の空気軸受36によって、対象物ステージのベース28の上方の空間に支持されている。あるいは、このサポートすなわち支持を行うためには、磁石及びコイルの組み合わせを採用することもできる。

【0016】XYステージ30はまた、直動型の駆動モータの如き磁気的な結合手段から成る適宜な要素も備えており、この要素は、ウエーハを、光学装置16のレンズにアライメントさせ、ウエーハの表面のホトレジストを露光するための像を正確に位置決めする。図示の実施例においては、磁気的な結合手段は、XYステージ30をX方向において位置決めするための、X駆動コイル42X、42X'の如き一对のX駆動部材と、XYステージ30をY方向において位置決めするための、駆動コイル44Y、44Y'の如き一对のY駆動部材とから成る形態を取る。反作用フレームアセンブリ60の上の磁気的な結合手段の関連する部分は、後に詳細に説明する。

【0017】XYステージ30は、一对のレーザミラー38X、38Yを備えており、上記レーザミラー38Xは、レーザ光線干渉計装置92の一对のレーザ光線40A/40A'に対して動作し、また、上記レーザミラー38Yは、上記干渉計装置の一对のレーザ光線40B/40B'に対して動作し、投影光学装置16の鏡筒PLの下方部にある固定ミラーRMXに対して、上記XYステージの正確なXY位置を決定し且つ制御する。

【0018】図8及び図9を参照すると、反作用フレームアセンブリ60は、複数のサポートポスト62を有する反作用フレーム61を備えており、上記サポートポストは、このサポートポストと対象物ステージとの間に振動が実質的に伝達されないように、地面又は別個のベースに取り付けられている。

【0019】反作用フレーム61は、サポートポスト62の間でX方向に伸長する面プレート64X、64X'と、サポートポストの間でY方向に伸長する面プレート66Y、66Y'とを備えている。面プレート64-66の内側には、複数の反作用フレームのレール67-69および67'-69'が設けられ、X従動子72及びY従動子82を支持して案内している。面プレート64Xの内側には、上方の従動子ガイドレール67、及び、下方の従動子ガイドレール68（図示せず）が設けられており、反対側の面プレート64X'の内側面には、上方及び下方の従動子ガイドレール67'、68'が設けられている。各々の面プレート66Y、66Y'の内側面には、ガイドレール67、68の間で垂直方向に配置された、単一のガイドレール69、69'がそれぞれ設けられている。

【0020】X従動子は、隔置された一对のアーム74、74'を備えており、これらアームの一端部は、横材76に固定されている。駆動トラック78、78'（図5参照）の如き駆動要素が、アーム74、74'にそれぞれ設けられ、XYステージの駆動要素42X、42X'と協働するようになされている。図示の実施例においては、XYステージの上の駆動要素42X、42X'は、駆動コイルとして示されているので、X従動子72の上の駆動トラックは、磁石の形態を取っている。

又、結合要素を逆転させ、コイルをX従動子の上にもうけ、磁石をXYステージの上に設けることもできる。XYステージが、X及びY方向に駆動される際に、レーザ干渉計装置92は、XYステージのその新しい位置を瞬時に検出し、位置情報（X座標の値）を発生する。図10を参照して後に詳細に説明するように、ホストプロセッサ（CPU）96に制御されるサーボ型の位置制御装置94が、干渉計装置92からの位置情報に応じて、X従動子72及びY従動子82の位置を制御し、駆動コイル42X、42X'とトラック74、74'との間を機械的結合することなく、XYステージ30に追従する。

【0021】X従動子72を反作用フレーム61に運動

可能に取り付けるために、反作用フレーム61の側にあるアーム74、74'の端部は、レール69の上に乗って案内され、アーム74、74'の反対側の端部は、面プレート66Y'に隣接するレール69'に乗っている。X従動子72を動かすために、駆動部材77が、横材76の上に設けられ、反作用フレームガイド69と協働して、XYステージのX方向に対して直交する方向に、従動子72を動かす。XYステージ30で正確な制御及び駆動が行われるので、X従動子72の位置決め制御は、XYステージ30程には、正確である必要はなく、又XYステージ程には、厳密な公差及びエアギャップを設ける必要はない。従って、駆動機構77は、モータによって回転されるネジ軸、及び、X従動子72に係合されるナットの組み合わせ、あるいは、リニアモータを形成するコイルアセンブリ及び磁石アセンブリの組み合わせとすることができ、上記各々の組み合わせは、ローラガイド機構と更に組み合わせることができる。

【0022】X従動子72と同様に、Y従動子82は、その一端部が横材86に固定された一対のアーム84、84'を備えており、これらアームは、Y駆動部材44Y、44Y'と協働するトラック88、88'を有している。Y従動子82のアーム84、84'は、別々のガイドレールの上で案内される。アーム84の両端部は、上方のレール67、67'の上に乗って案内され、また、アーム84'の両端部は、下方のレール68、68'の上で案内される。駆動機構87は、Y従動子82の横材86に設けられ、Y従動子82を、面プレート66Yと66Y'との間で、ガイド67、67'、及び、68、68'に沿って、XYステージのY方向に直交する方向に動かす。

【0023】図9に最も良く示すように、X従動子72のアーム74、74'及び横材76は総て、Z軸線と直交する同一の平面において配置され、動く。XYステージ30の重心は、上記平面の中にあるか、又は、該平面に直ぐ隣接している。この構造においては、各々の駆動コイル42X、42X'からの駆動力は、アーム74、74'の長さにそれぞれ沿う方向に働く。しかしながら、Y従動子82のアーム84、84'は、Z軸線に沿って互いに隔置され、それぞれは、X従動子72を含む平面の上方及び下方にありかつ、この平面に平行な別々の平行な平面の中にあつてその平面の中で動く。好ましい実施例においては、横材86は、アーム84'を含む下方の平面の中にあり、スペーサブロック86'が、アーム84及び横材86の重なり合う端部の間に位置し、アーム84、84'をそれぞれの平行な平面に隔置している。X従動子72と同様に、各々の駆動コイル44Y、44Y'からの駆動力は、アーム84、84'の長さに沿う方向に働く。また、駆動コイル44Y(44Y')と駆動トラック88(88')との間で、X方向及びZ方向に所定のギャップが維持され、ガイドレスの

概念を達成している。

【0024】本発明のガイドレスステージ、及び、振動絶縁型の反作用フレームが作動する際には、XYステージ30が、干渉計装置92によって検知された、投影レンズに対する初期位置に位置決めされ、XYステージ30は、駆動トラック78、78'、88、88'の構成による駆動要素から駆動コイル42X、42X'、44Y、44Y'が隔置された状態で空気軸受によって、対象物ステージのベース28から、Z方向に支持される。XYステージ30と反作用フレーム61との間には、接触は全くない。すなわち、反作用フレームの振動が伝わって、XYステージの位置に影響を与える経路、あるいは、その反対の経路は全く存在しない。信号をコイルに送る伝達手段、並びに、レーザ干渉計の位置検知装置を介する間接的な接触が存在するだけであり、上記位置検知装置は、検知した位置情報をコントローラすなわち制御装置へ送り、該制御装置は、XYステージ30の運動を生じさせる駆動信号を開始する他のコマンドを受け取る。

【0025】干渉計装置92からのXYステージの位置が分かると、駆動信号が、位置制御装置94から、適当な駆動コイル42X、42X'、44Y、44Y'に送られ、XYステージを新しい所望の位置へ駆動する。XYステージの運動は、干渉計装置92及び位置センサ98X、98Y(図10参照)によって検知され、X従動子72及びY従動子82は、それぞれ駆動部材77、87によって駆動され、XYステージに追従する。図10に示すように、位置センサ98Xは、XYステージ30とX従動子72との間のY方向の間隔の変動を検知し、その間隔の値を表す電気信号を位置制御装置94へ送る。位置制御装置94は、干渉計装置92からのX位置、並びに、位置センサ98Xからの信号に基づき、駆動部材77に関する適正な駆動信号を発生する。

【0026】また、位置センサ98Yは、XYステージ30とY従動子82との間のX方向の間隔の変動を検知し、その間隔の値を表す電気信号を発生し、駆動部材87が、干渉計装置92からのY位置の情報、並びに、位置センサ98Yからの信号に基づき、駆動される。

【0027】ヨー角度補正はヨー角度を維持あるいは補正するために使用できる、モータ対によって行われる。すなわち、上記モータ対は、XYステージの回転方向の位置を変更することができる。レーザ光線40A/40A'及び40B/40B'の一方又は両方からのデータが、ヨー角度情報を得るために使用される。レーザ光線40A、40A'あるいは40B、40B'を用いた測定から得たデジタル位置データの電子的な減算を実行するか、あるいは、両者の差分を加えて2で割る。

【0028】本発明は、XYガイドを用いた場合よりも、より迅速にXYステージの位置決め機能を実行することを可能とする。XYステージが動く際に生ずる反力

は、像形成光学系及びレティクル処理機構機器から分離される。

【0029】本発明は、ガイドされるステージに比較して、正確なXガイド又はYガイドを全く必要とせず、精密なガイドがないので、ウエーハのXYステージの精密な組み立て及び調節の操作が減少する。XY軸線におけるリニアモータの力が、ウエーハのステージに直接作用する、つまり上記リニアモータは、ガイド装置を介して作用する必要がないので、サーボの制御帯域幅が増大する。

【0030】XYリニアモータからの力は総て、実質的にXYステージの重心を通して伝達させることができ、これにより、望ましくない力のモーメント（トルク）を排除する。

【0031】互いに完全に独立して備えられ且つ作動するX従動子72及びY従動子82を用いて、各々の従動子72、82とXYステージ30との間の磁気カップリングとして商業的に入手可能な電磁リニアモータを使用し、コイルと磁石駆動トラックとの間の間隙を約1mmよりも小さくすると、従動子のいかなる振動も、ウエーハのXYステージ、あるいは、光学装置に伝達されない。また、一方の従動子のアームを他方の従動子のアームの上方及び下方に隔置すると、XYステージの重心における力のモーメントのベクトル和は、協働する駆動部材の位置決め力により、実質的にゼロに等しくなる。

【0032】XYステージと各従動子ステージとの間には、これらステージの間にX、Y、又は θ の自由度で振動が伝わるのを許容する接続部が全く存在しないと考えることができるであろう。これにより、従動子ステージは、ウエーハのステージの性能に影響を与えることなく、振動する基準フレームに取り付けることができる。例えば、反作用フレームが、障害物と当たった場合には、XYステージ及び投影光学装置は影響を受けないだろう。

【0033】重心が、いずれかの2つのX駆動コイルといずれかの2つのY駆動コイルとの間で等距離にない場合には、大きさの異なる適宜な信号が、それぞれのコイルに送られてより大きな力をステージのより重たい側に与えられ、これにより、XYステージを所望の位置へ駆動することは、当業者には理解されよう。

【0034】特定の用途に対しては、電磁力を運動可能なXYステージに与えるための、アクチュエータすなわち磁気結合アセンブリの駆動要素42X/42X'又は42Y/42Y'を、X方向又はY方向におけるステージの運動に関して、それぞれ静止した状態で一定位置に保持することができる（図10参照）。

【0035】本実施例の最後の説明として、図4を再度参照して、本発明の本質的構造を説明する。図4に示すように、XYステージ30は、空気排出ポート及び真空予圧ポートを有する空気軸受36によって、ステージベ

ース28の平坦で円滑な表面（X-Y平面に平行な）の上に担持されており、何等摩擦を受けることなく、ステージベース28の上でX、Y及び θ 方向に運動することができる。

【0036】ステージベース28は、振動絶縁ブロック20、アーム18、ブロック22、垂直なバー26、及び、水平なバー27によって、基礎（あるいは、地面、又は、ベース構造）の上に担持されている。各々の振動絶縁ブロック20は、基礎21からの振動の伝達を防止する振動吸収アセンブリを備えている。

【0037】図4は、駆動コイル42X、42X'をY方向に通る線に沿うXYステージ30の断面図であるので、以下の説明は、X従動子72に限定される。図4においては、駆動コイル42Xは、従動子のアーム74に装着された駆動トラック（X方向に細長い磁石の列）78の磁場の中に設けられており、駆動コイル42X'は、従動子のアーム74'に装着された駆動トラック78'の磁場の中に設けられている。

【0038】2つのアーム74、74'は、反作用フレーム61の内側に形成されたガイドレール69、69'によって、一緒にY方向に動くように、堅固に組み立てられている。また、ガイドレール69、69'は、2つのアーム74、74'のX及びZ方向の運動を制限する。反作用フレーム61は、4つのサポートポスト62によって、ステージベース28とは独立して、基礎21の上で直接支持されている。

【0039】従って、駆動コイル42X（42X'）及び駆動トラック78（78'）は、Y及びZ方向において所定のギャップ（数ミリメートル）を維持するように、お互いに配列されている。従って、駆動コイル42X、42X'が駆動されてXYステージ30をX方向に動かすと、駆動トラック78、78'に生じた反力は、基礎21へ伝達され、XYステージ30には伝達されない。

【0040】一方、XYステージ30がY方向に動く時には、2つのアーム74、74'が、駆動部材77によって、Y方向へ動き、これにより、各々の駆動トラック78、78'は、位置センサ98Xの測定信号に基づき、それぞれのコイル42X、42X'に追従し、Y方向のギャップを維持する。

【0041】本発明は、一対の駆動部材、すなわち、コイル42X、42X'、並びに、一対の駆動部材、すなわち、コイル44Y、44Y'を備える好ましい実施例を参照して説明したが、図11及び図12に示す如き、丁度3つの駆動部材すなわちリニアモータを有する本発明に従って振動絶縁反作用フレームと、ガイドレスステージを構成することができる。図11に示すように、一対のY駆動コイル144Y、144Y'が、ステージ130に設けられ、また、単一のX駆動コイルすなわちリニアモータ142Xが、XYステージの重心CG'に合

わせて設けられている。Y駆動コイル144Y、144Y'は、Y従動子182のアーム184、184'に設けられ、また、X駆動コイル144Xは、X従動子172のアーム174'に設けられている。適宜な駆動信号を駆動コイル142X、144Y、144Y'に与えることにより、XYステージを所望のXY位置へ動かすことができる。

【0042】次に、図13乃至図16を参照すると、本発明の別の実施例が示されており、この実施例は、XY駆動コイル242X、242X'、244Y、244Y'とXYステージ30'への取付部との間に、リンクを備えている。これらの結合部は、駆動コイル244Yを結合部材320の一端部に結合する複式の板ばねアセンブリ300と、結合部材320の他端部をXYステージ30'に結合する複式の板ばねアセンブリ320とを備えている。複式の板ばねアセンブリ300は、コイル244Yに固定されたフランジ302を有している。クランプ部材304が、クランプボルトを介して、フランジ302に取り付けられており、水平な可撓性のリンク306の一方の縁部をその間に挟んでいる。可撓性のリンク306の他端部は、2つの水平な部材308の間に挟まれており、これら水平な部材は、順に垂直なフランジ310と一体に固定され、この垂直なフランジには、一対のフランジ部材312がボルト止めされており、該一対のフランジ部材は、垂直な可撓性の部材314の一方の縁部を挟んでいる。垂直な可撓性の部材314の他方の縁部は、一対のフランジ部材316の間に挟まれており、該一対のフランジ部材は、順に固定部材320の一端部のフランジプレート318にボルト止めされている。固定部材320の他端部では、プレート348が、2つのフランジ部材36に固定されており、これら2つのフランジ部材は、垂直な可撓性の部材344の一端部を挟むように互いにボルト止めされている。垂直な部材344の反対側の縁部は、フランジ部材342によって挟まれており、これらフランジ部材は、順に水平な可撓性の部材336の一方の縁部を挟む一対のクランププレート338に固定されたプレート340に固定されており、上記水平な可撓性の部材の反対側の縁部は、プレート334の助けを受けて、XYステージ30'に挟み付けられている。従って、各々の複式の板ばねアセンブリ300、330においては、水平な及び垂直な可撓性の部材の両方を設けることにより、振動が減少される。これら各々のアセンブリにおいては、垂直な可撓性の部材が、X、Y及び θ の振動を減少させ、また、水平な可撓性の部材が、Z、傾斜及び横転方向の振動を減少させる。従って、X、Y、 θ に関する、8つの垂直方向のたわみジョイント、並びに、Z、傾斜及び横転方向に関する、8つの水平方向のたわみジョイントが設けられる。

【0043】図16に示すように、コイル244Yは、コイルサポート245Yに取り付けられ、該コイルサポ

ートは、これに取り付けられた上方のサポートプレート246を有しており、該上方のサポートプレートは、磁気トラックアセンブリ288の頂部に乗っている。真空予圧型の空気軸受290が、一方としてコイルサポート245Yと上方のサポートプレート246と、また、他方として磁気トラックアセンブリ288との間に設けられている。図13乃至図16に示す実施例の作動例においては、可撓性の部材306、314、344、336は、幅が約31.8mm(1 1/4インチ)、長さが約6.4mm(1/4インチ)及び厚みが0.305mm(0.012インチ)のステンレス鋼であり、その一次たわみ方向は、厚みの方向である。図示の実施例においては、部材306、314は、それぞれの一次たわみ方向を互いに直交させた状態で、直列に配列されており、部材344、336も同様に配列されている。

【0044】本発明を好ましい実施例に関して説明したが、本発明は多くの異なる形態を取ることができ、本発明の範囲は、請求の範囲によってのみ限定されるものである。

20 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を採用したマイクロリソグラフ装置の斜視図である。

【図2】図1において線A-Aで示す構造の一部の斜視図であって、図1に示す反作用ステージは省略してある。

【図3】図1に示す構造を一部断面で示す立面図である。

【図4】本発明の対象物位置決め装置を一部断面で示す概略的な立面図である。

30 【図5】反作用ステージ上方にあるウエーハのXYステージ位置の平面図である。

【図6】図5に示す構造の一部を線6-6に沿って矢印の方向に示す側方立面図である。

【図7】図6において線B-Bで示す構造の一部の拡大図である。

【図8】XYステージの位置決めを行うためにXYステージに固定された手段を取り除いてXY従動子を示す、反作用ステージの斜視図である。

【図9】図8に示すXY従動子の拡大斜視図である。

40 【図10】本発明の好ましい実施例の位置検出及び制御装置の概略的なブロックダイアグラムである。

【図11】本発明の別の実施例を示す、図5と同様な平面図である。

【図12】図11の実施例を示す、図6と同様な側方立面図である。

【図13】本発明の更に別の実施例を示す、図5と同様な平面図である。

【図14】図13の実施例を示す、図6と同様な側方立面図である。

50 【図15】図13に示す構造の一部の拡大上面図であ

17

18

る。

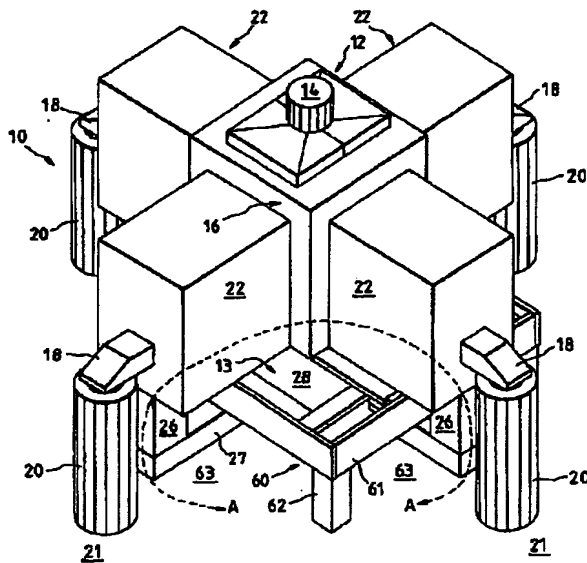
【図16】図15の線16-16に沿って矢印の方向に示す上記構造の端面図である。

【符号の説明】

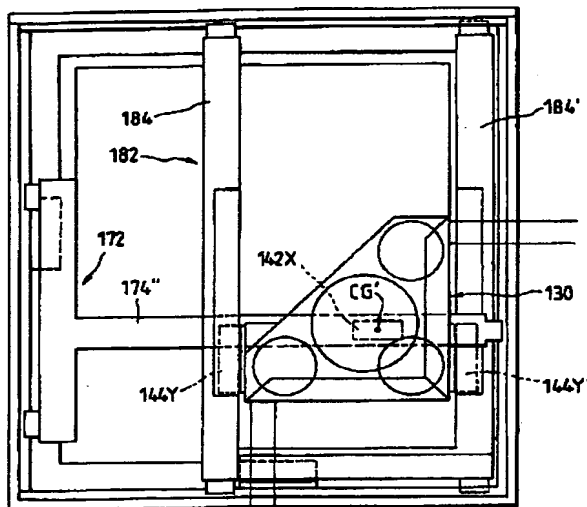
- 10 ホトリソグラフ装置
- 12 光学装置（光学系）
- 28 対象物ステージのベース
- 30 XYステージ
- 34 対象物（ウエーハ）

- 36 空気軸受
- 42 X, 42 X' X駆動部材（X駆動コイル）
- 44 Y, 44 Y' Y駆動部材（Y駆動コイル）
- 60 反作用フレームアセンブリ
- 61 反作用フレーム
- 72 X従動子
- 74, 74' X従動子のアーム
- 82 Y従動子
- 84, 84' Y従動子のアーム

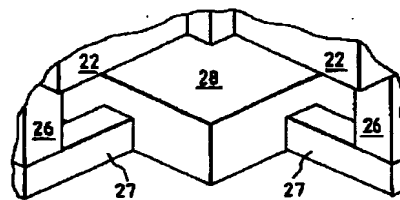
【図1】



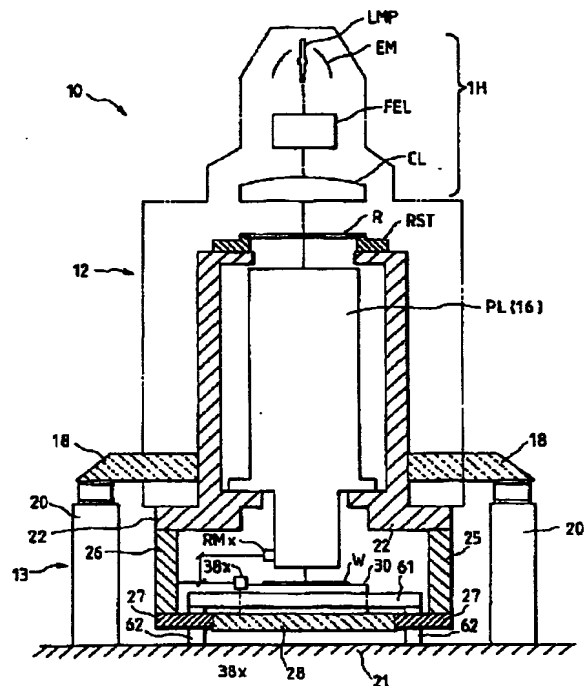
【図11】



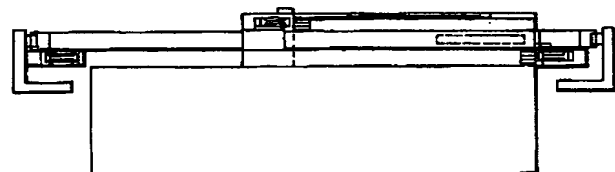
【図2】



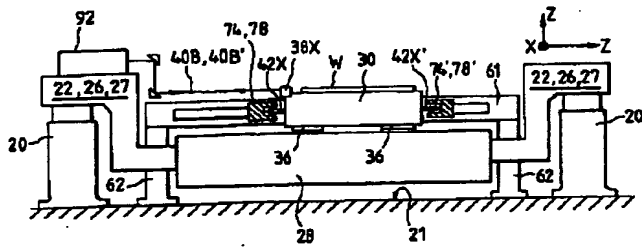
【図3】



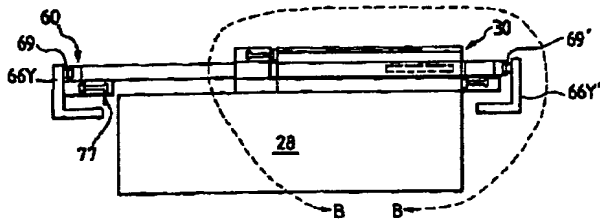
【図14】



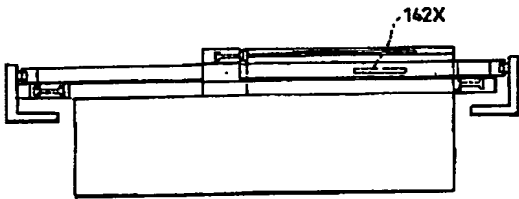
【図 4】



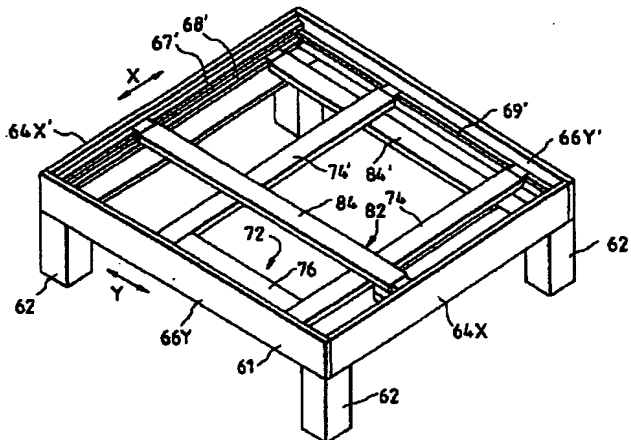
【図 6】



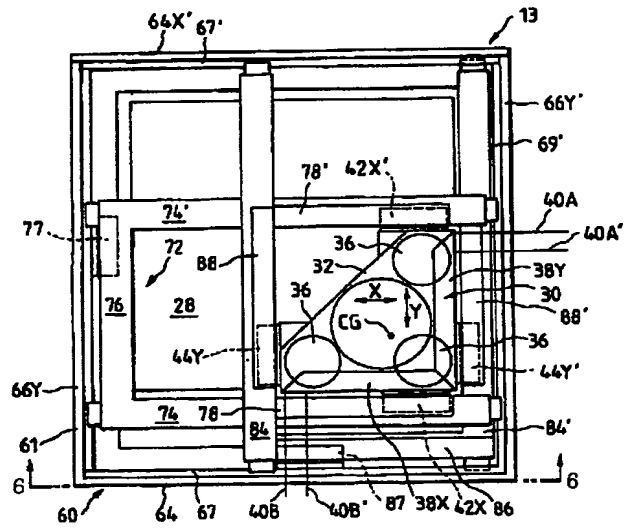
【図 12】



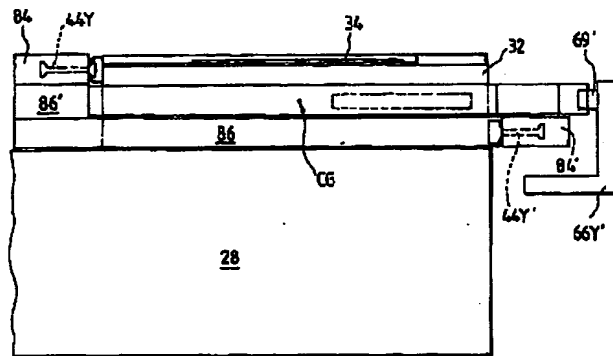
【図 8】



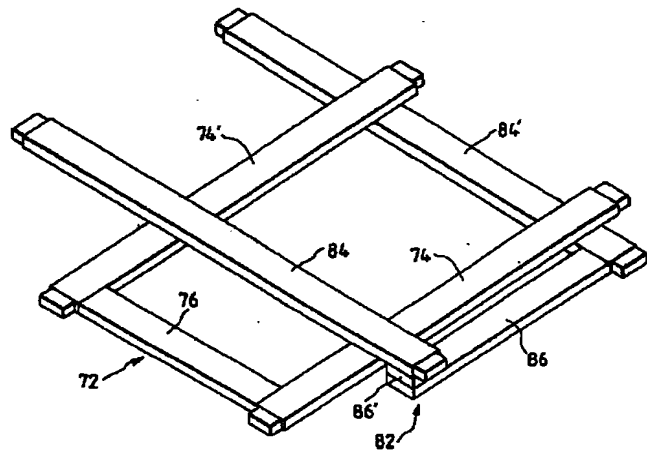
【図 5】



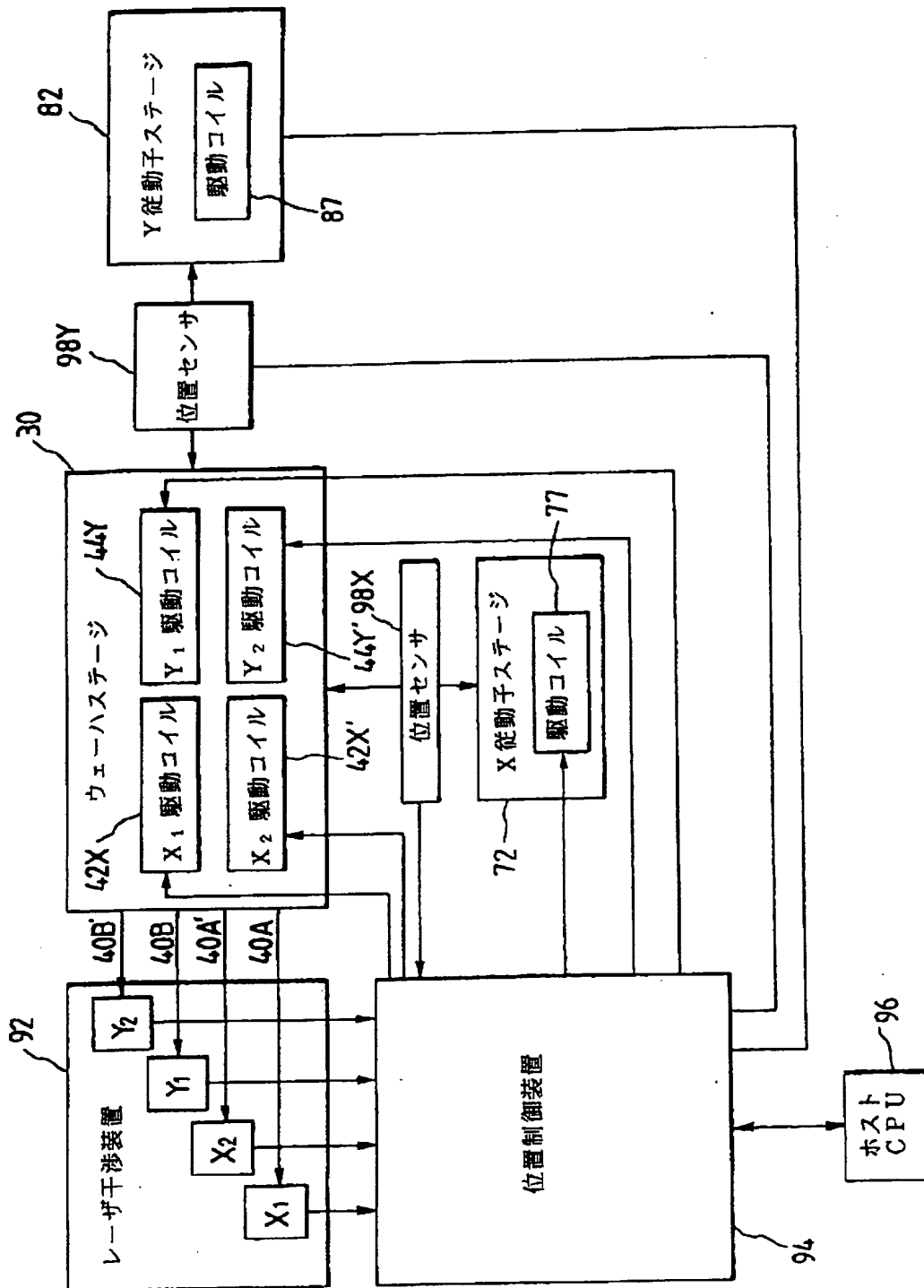
【図 7】



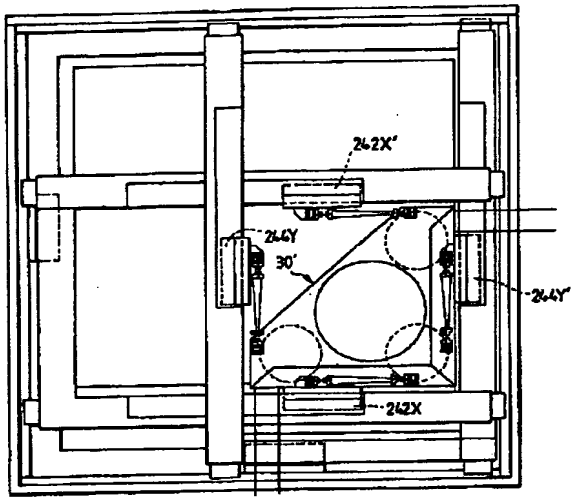
【図 9】



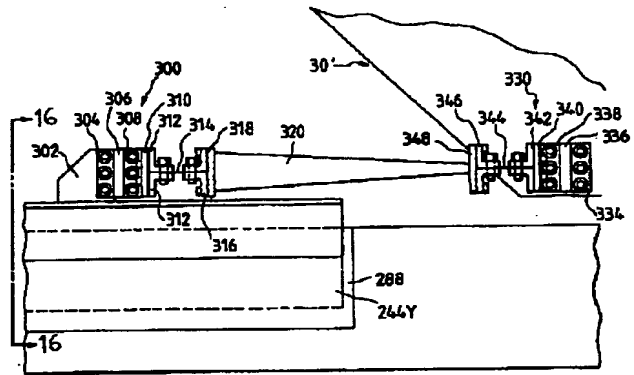
【図10】



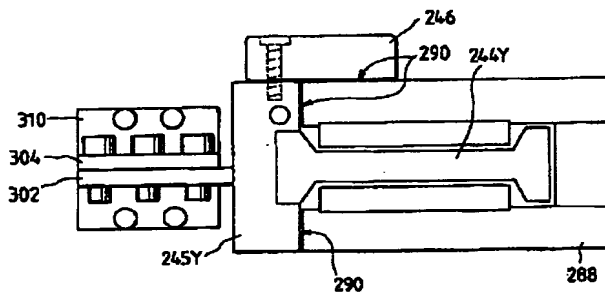
【図 13】



【図 15】



【図 16】



31/3.

/3/1

ALOG(R)File 351:Derwent WPI

) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

0437667 **Image available**

I Acc No: 1995-338984/199544

PX Acc No: N95-254336

sitioning system for semiconductor wafer alignment in microlithography
has reaction frame assembly, guideless object stage with support and
sitioned by cooperating force type linear actuator and isolated from
s reaction forces and ground vibration

tent Assignee: NIKON PRECISION INC (NIKR); NIKON CORP (NIKR)

ventor: LEE M E

mber of Countries: 004 Number of Patents: 017

tent Family:

tent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
2288277	A	19951011	GB 956629	A	19950331	199544 B
5528118	A	19960618	US 94221375	A	19940401	199630
8166475	A	19960625	JP 9575223	A	19950331	199635
2288277	B	19980225				199811
5744924	A	19980428	US 94221375	A	19940401	199824
			US 96627824	A	19960402	
			US 96668584	A	19960620	
5942871	A	19990824	US 94221375	A	19940401	199941
			US 96627824	A	19960402	
5982128	A	19991109	US 94221375	A	19940401	199954
			US 96627824	A	19960402	
			US 9818593	A	19980204	
6049186	A	20000411	US 94221375	A	19940401	200025
			US 96627824	A	19960402	
			US 98127288	A	19980731	
6271640	B1	20010807	US 94221375	A	19940401	200147
			US 96627824	A	19960402	
			US 98127288	A	19980731	
			US 99437608	A	19991110	
6281654	B1	20010828	US 94221375	A	19940401	200151
			US 96627824	A	19960402	
			US 99310925	A	19990513	
20010030522	A1	20011018	US 94221375	A	19940401	200166
			US 96627824	A	19960402	
			US 98127288	A	19980731	
			US 99437608	A	19991110	
			US 2001880859	A	20010615	
300204	B	20011029	KR 957886	A	19950401	200238
			KR 9917271	A	19990514	
291820	B	20011130	KR 957886	A	19950401	200246
318638	B	20020118	KR 957886	A	19950401	200254
			KR 9917270	A	19990514	
2003109899	A	20030411	JP 9575223	A	19950331	200334
			JP 2002235566	A	19950331	
2003115452	A	20030418	JP 9575223	A	19950331	200335
			JP 2002235567	A	19950331	
2003178961	A	20030627	JP 9575223	A	19950331	200351
			JP 2002235568	A	19950331	

riority Applications (No Type Date): US 94221375 A 19940401; US 96627824 A
19960402; US 96668584 A 19960620; US 9818593 A 19980204; US 98127288 A
19980731; US 99437608 A 19991110; US 99310925 A 19990513; US 2001880859 A
20010615

tent Details:

tent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
3 2288277	A		35	H01L-021/00	
3 5528118	A		18	G03B-041/16	

8166475	A	13	G12B-005/00	
5744924	A	18	G03B-041/16	Cont of application US 94221375
				Cont of application US 96627824
				Cont of patent US 5528118
5942871	A		G05B-005/01	Cont of application US 94221375
				Cont of patent US 5528118
5982128	A		B64C-017/06	Cont of application US 94221375
				Cont of application US 96627824
				Cont of patent US 5528118
				Cont of patent US 5942871
6049186	A		G05B-005/01	Cont of application US 94221375
				Cont of application US 96627824
				Cont of patent US 5528118
				Cont of patent US 5942871
6271640	B1		G05B-011/01	Cont of application US 94221375
				Cont of application US 96627824
				Div ex application US 98127288
				Cont of patent US 5528118
				Cont of patent US 5942871
6281654	B1		H01L-021/68	Cont of application US 94221375
				Cont of application US 96627824
				Cont of patent US 5528118
				Cont of patent US 5942871
20010030522	A1		G05B-011/01	Cont of application US 94221375
				Cont of application US 96627824
				Div ex application US 98127288
				Div ex application US 99437608
				Cont of patent US 5528118
				Cont of patent US 5942871
				Div ex patent US 6049186
				Div ex patent US 6271640
300204	B		H01L-021/30	Div ex application KR 957886
291820	B		H01L-021/30	Previous Publ. patent KR 95034541
318638	B		H01L-021/30	Div ex application KR 957886
2003109899	A	14	H01L-021/027	Div ex application JP 9575223
2003115452	A	13	H01L-021/027	Div ex application JP 9575223
2003178961	A	14	H01L-021/027	Div ex application JP 9575223